物理学报 Acta Physica Sinica



强激光辐照对 3C-SiC 晶体结构稳定性的影响 邓发明 高涛 沈艳红 龚艳蓉

Effect of intense laser irradiation on the structural stability of 3C-SiC

Deng Fa-Ming Gao Tao Shen Yan-Hong Gong Yan-Rong

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 64, 046301 (2015) DOI: 10.7498/aps.64.046301 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.046301 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I4

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

N/Cu共掺杂锐钛矿型TiO2第一性原理研究

First-principles study of N/Cu co-doped anatase TiO₂ 物理学报.2015, 64(4): 047101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.047101

MoSi₂薄膜电子性质的第一性原理研究

Firstprinciples study of electronic properties of MoSi₂ thin films 物理学报.2015, 64(4): 047102 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.047102

金属Fe与间隙H原子相互作用的密度泛函研究

First principles investigation of interaction between interstitial hydrogen atom and Fe metal 物理学报.2014, 63(22): 227101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.227101

应力对硅烯上锂吸附的影响 Effect of strain on Li adsorption on silicene 物理学报.2014, 63(21): 217101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.217101

Ti 掺杂 W₁₈O₄₉ 纳米线的电子结构与 NO₂ 敏感性能的第一性原理研究 First-principles study of the electronic structure and NO₂-sensing properties of Ti-doped W₁₈O₄₉ nanowire 物理学报.2014, 63(20): 207101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.207101

强激光辐照对3C-SiC晶体结构稳定性的影响 *

邓发明^{1)2)†} 高涛^{2)‡} 沈艳红²⁾ 龚艳蓉²⁾

(四川民族学院数学系,康定 626001)
 (四川大学原子与分子物理研究所,成都 610065)
 (2014年7月7日收到; 2014年9月17日收到修改稿)

使用基于密度泛函微扰理论的线性响应方法,模拟研究了强激光辐照对闪锌矿结构的碳化硅晶体结构稳定性的影响.通过计算在不同电子温度下 3C-SiC 晶体的声子色散曲线,发现 3C-SiC 的横声学声子频率随电子温度的升高会出现虚频,其临界电子温度是 3.395 eV.结果表明,在强激光辐照下 3C-SiC 晶体变得不稳定,这与以前对金刚石结构的碳、硅和闪锌矿结构的砷化镓、锑化铟的研究结果非常类似.电子温度在 0—4.50 eV 范围内时, 3C-SiC 晶体在 Γ 点的 LO-TO 分裂度随电子温度的升高而增大,超过 4.50 eV 后随电子温度的升高而减小.这表明只有在足够强的激光辐照下,电子激发才会削弱晶体的离子性强度.

关键词: 3C-SiC, 晶格稳定性, 激光辐照, 密度泛函微扰理论
 PACS: 63.10.+a, 71.15.mb, 61.72.uj, 81.10.Aj
 DOI: 10.7498/aps.64.046301

1引言

自然界中的超快、强场等极端物理现象一般 只出现在恒星内部、黑体边缘和核爆炸中心.随着 激光技术的快速发展,特别是近十年超快激光脉 冲的发展与应用,促使这种超快、强场等极端物理 条件可以在实验尺度内得以实现,进而极大地推 动了激光与物质相互作用的理论与实验研究.van Vechten等^[1]认为,当一个超短脉冲激光与半导体 相互作用时,转移到半导体的超短激光的能量因电 子吸收首先存储在电子系统中,在很短的几十飞秒 内,材料中的电子被加热到很高温度10⁴ K,通过电 子与电子、电子与空穴的极速碰撞,并迅速达到其 电子温度*T*e导致晶格非热熔化.

自从 van Vechten 等^[1]提出了非热熔化观点以 后,大量的实验和理论研究已经证实在半导体中 存在非热能的影响. Shank 等^[2]用飞秒激光器输 出的激光辐照硅原子,对其发生的非热相变进行

了讨论, Larsson 等^[3] 在激光辐照时使用X射线散 射晶体的方法观察到了锑化铟存在一种快速相变. 晶体镓已经被证明在强激光脉冲辐照数时皮秒后 出现过渡相^[4]. Saeta 等^[5]观察到砷化镓被强烈的 飞秒激光辐照后发生的突然电子相位变换,并证 实电子激发直接导致晶格畸变. 由于非热能的熔 化,在电子激发下晶格稳定性已经引起了物理学 和材料科学领域科学家的广泛关注和浓厚的兴趣. 在 van Vechten 等^[1]的研究中指出,由于电子系统 的激发使金刚石结构的半导体材料变得不稳定. Silvestrelli 等^[6,7] 使用基于密度泛函理论的从头开 始分子动力学方法来模拟硅晶格的不稳定. 通过分 析声子谱对电子温度的演变, Recoules 等^[8] 讨论了 在强大的激光辐照下半导体和金属的晶格稳定性. 基于从头计算方法, Zijlstra 等^[9] 研究了锑化铟激 光诱导前期的超快非热熔化.

碳化硅(SiC)作为新型的间接带隙半导体晶体 材料,其与硅相比具有更宽的禁带、更高的击穿电 压、更高的电子饱和漂移速度、更高的电子迁移

^{*} 国家科技支撑计划(批准号: 2014GB111001, 2014GB125000)资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: dfm@scun.edu.cn

[‡]通信作者. E-mail: gaotao@scu.edu.cn

^{© 2015} 中国物理学会 Chinese Physical Society

率、更高的热导率、化学稳定性好等优越性能^[10,11], 故在高频、高温、高功率和抗辐射器件,存储器件 以及光电集成器件等设备制备方面有其特殊的应 用^[12,13].研究也发现,在恶劣环境下SiC作为一种 较理想的短波发光材料,其优越的性能是传统半导 体材料如Si, GaAs等所无法可比的^[14]. 据我们所 知,近年来关于闪锌矿结构的SiC(即3C-SiC)的报 道有常温常压下不同方法的能带结构计算[15]、高 压相变下几何结构重构后的能带结构计算^[16]、掺 杂后第一性原理研究[17]等方面,而强激光辐照诱 导下的非热相变研究很少.为了调查3C-SiC在强 激光辐射下晶体结构的变化,本文采用密度泛函微 扰理论的线性响线方法, 计算了 3C-SiC 在不同电 子温度Te下的声子谱,分析3C-SiC晶体在强激光 辐照下的晶格结构稳定性. 检测到强激光辐照下使 3C-SiC晶体的横声学模(TA)的模频率完整地变为 虚频的临界电子温度 $T_{\rm e} = 3.395$ eV, 晶体结构变得 不稳定. 我们认为随着电子温度的升高, 3C-SiC晶 体的电子可能快速地热激发,以及电子-声子耦合 使得其系统能量增加,进而导致晶格不稳定性.同 时也检测到当电子温度升高到3.2 eV 后, 3C-SiC 晶体在高对称点L 点和X 点的两支TA 不再是简 并的,且差距随电子温度的继续升高而增大;在 Γ点纵光学模 (longitudinal optical, LO) 和横光学 模 (transverse optical, TO)的 LO-TO 分裂度 δω 在 0-4.5 eV范围内随电子温度的升高而增大,晶体 的离子性增强, 而超过4.5 eV 后分裂度δω 随电子 温度的升高而减小,这时晶体的离子性逐渐减弱, 而其金属性逐渐增加. 3C-SiC晶体在强激光照射 下所表现的这些物理性质,可以为制作3C-SiC晶 体特殊功能器件提供第一性原理的基础数据.

2 计算描述

本文计算采用 ABINIT 程序包 ^[18,19],选取广 义梯度近似 (generalized gradient approximation, GGA) 作为赝势 ^[20]. 首先我们选取模守恒 GGA 赝 势对截止能量和 k 点网格进行收敛研究,以确保这 两个参数的选取能使计算结果有很好的收敛性. 经 过测试,我们得到在截止能量为 30 Hartree 和 k 点 网格为 $6 \times 6 \times 6$ 时,体系的总能得到很好的收敛. 然后我们再对晶格常数进行优化,利用优化好的晶 格常数计算 3C-SiC 的声子谱. 用 ABINIT 程序包 的变量 tphysel 设置电子温度 $T_{\rm e}$ 的大小 (tphysel 值 的大小反映了激光的强弱),用于模拟强激光对晶 体辐照在超快时间内使晶体达到电子温度.电子温 度是指激光照射到物体上,电子运动时会产生动能 同时温度也会发生改变.激光能量密度是指激光照 射到物体上时,单位体积内物质储存能量的大小. 电子温度和激光能量密度量纲是不同的,电子温度 的单位是 eV, 其量纲是 $ML^{2}T^{-2}$,激光能量密度的 单位是 J/m³,量纲是 $ML^{-1}T^{-2}$.

在下面的计算中,由体系总能量最小化而优化 得到晶格参数,使用基于密度泛函微扰理论的线性 响应方法计算声子色散曲线.声子色散曲线的计 算选取了沿布里渊区的*W-L-Γ-X-W-K*高对称点. 与直接比较方法或冻结声子法对比,线性响应方法 避免了超晶胞的使用和任意*Q*矢量的动力学矩阵, 而是采用计算动态矩阵之后,用插值法得到在倒格 矢空间任意点的声子色散关系.

3 结果与讨论

3.1 晶格优化

3C-SiC是一种具有闪锌矿晶体结构的间接带 隙半导体,属于F43M空间群(群号216).其中,Si 的价电子态是3s²3p², C的价电子态是2s²2p². 首 先,确定3C-SiC的基态结构参数.通过晶胞体积 和总能量的最小化得到平衡时的晶格参数. 体积 直接关系到晶格参数a,由于3C-SiC具有很高的 对称性,因此不必优化原子的位置.交换关联相 互作用采用GGA 赝势. 计算得到的平衡晶格参数 a = 4.332 Å, 与实验值 4.35 Å^[21] 非常接近, 与实 验数据相比计算值仅低估了0.414%,也与文献[22, 23] 计算的平衡晶格参数值 4.34 Å 和 4.331 Å 具有 很好的一致性. 这在很大程度上可以保证对晶格动 力学属性做进一步研究的正确性. 另外, 由于与传 统的热熔解过程能量吸收时间较长不同,强激光辐 照晶体时能量的转移是一个飞秒时间的超快非热 熔化过程,当考察某强度的激光作用于晶体时,该 激光作用晶体前一时刻可以认为晶体结构是稳定 的,在该强激光的超快作用后晶体才可能变得不稳 定. 正因为这样的处理, 因此可以认为不同强度激 光辐照晶体前其晶体结构是稳定的,可以不再重新 进行晶体结构优化.

3.2 晶格参数 a 随电子温度 T_e的变化

由强烈的激光脉冲辐照, 在极短的时间内半导体 3C-SiC的电子加热到非常高的温度. 我们分别 测试了电子温度 T_e 在0—8 eV范围内的 24 组数据, 如图 1 所示. 从图 1 可以看出:在 $T_e = 0$ eV时, 晶格参数 a = 4.332Å, 电子温度在 0—1 eV范围内时, a 值稍微增大;当 T_e 大于1 eV后, a 值增加较明显. 在强激光辐照时, 3C-SiC 晶体晶格快速吸收能量, 越来越多的价电子激发进入导带, 削弱了原子间的吸引力, 原胞内的硅原子和碳原子在自身平衡位置附近的非简谐热振动加剧, 原子间的相互斥力加大, 晶格的力学平衡被打破, 晶格参数修复到一个新的值以保持新的晶格力学平衡. 在强激光辐照



图 1 3C-SiC 晶格参数 a 随电子温度 T_e 的变化

下,我们得到3C-SiC晶格常数随电子温度升高而 增大的情况与Feng等^[24]对金刚石结构的碳计算 结果非常类似,以及和文献[25,26]对硅晶体的实 验结果也十分类似.

3.3 强激光辐照下的晶格动力学属性

3.3.1 两个不同电子温度下的声子色散曲线

为考察3C-SiC晶体电子激发对其稳定性 的影响, 在 $T_{\rm e} = 0$ eV和高电子温度下计算 了 3C-SiC 的声子色散曲线. 表1列出了 T_{e} = 0 eV 时 计 算 得 到 的 3C-SiC 在 布 里 渊 区 的 一 些 高对称点的声子频率ω值,并与其他研究工 作的理论计算值和实验值进行比较. 在 Γ 点,本文计算得到的TO和LO声子频率值分 别为791.68 cm⁻¹和914.02 cm⁻¹,其中TO声子 频率与实验值795 cm^{-1 [27]}和796.2 cm^{-1 [28,29]}有 很好的一致性, 而LO声子频率稍低于实验值 972 cm^{-1 [27]}和972.7 cm^{-1 [28,29]}; 对于X点,本文 计算的LA声子频率稍微低于实验值^[27-29],而TA, TO和LO的声子频率与实验值^[27-29]有很好的一 致性; 在L点, 本文计算的TA, LA, TO和LO的 声子频率与实验值[27-29]符合得很好.因此,在 $T_{\rm e} = 0$ eV时本文计算的声子频率在高对称点(Γ , X和L点)与使用不同方法获得的实验值^[27-29]与 理论计算值^[30,31]均具有很好的一致性.

位置	声子模式	$\omega/{ m cm}^{-1}$				
		本文计算值	实验值 ^[27]	Raman 实验值 ^[28,29]	计算值 ^[30]	计算值 ^[31]
Г	ТО	791.68	795	796.2	783	793.1
	LO	914.02	972	972.7	956	974.8
X	TA	363.26	372	373	366	370.2
	LA	616.57	639	640	629	635.1
	ТО	771.01	760	761	755	763.8
	LO	829.32	829	829	829	834.4
L	TA	258.65	261	266	261	263.6
	LA	603.66	610	610	610	615.9
	ТО	772.77	765	766	766	767.1
	LO	837.30	837	838	838	845.6

表1 $T_e = 0$ eV 时本文计算的 3C-SiC 的声子频率 ω 与其他实验值和理论计算值的比较

图 2 显示了计算得到的 3*C*-SiC 晶体在电子温度 $T_{\rm e} = 0$, 3.395 eV下的声子色散曲线. 首先, 我 们发现当电子温度升高到 $T_{\rm e} = 3.395$ eV 时声子谱 发生了明显的变化, 除两个低频的 TA 外 3*C*-SiC 所

有的模频率 ω 随电子温度的升高一致性地朝下移动. 在 $T_{\rm e} = 3.395$ eV时整个晶格不稳定, 因为晶格内各点的两支TA频率 ω 完整地变为虚频(图2中显示为负数). 随着电子温度的升高, 3*C*-SiC 晶体

的电子快速地热激发,而电子-声子耦合使得系统 能量增加,进而导致整个晶格的不稳定性.这与 Recoules等^[8]利用线性响应方法对硅的理论计算 结果相似,也与Feng等^[24]利用线性响应方法对具 有闪锌矿结构的GaAs和InSb半导体晶体的理论 计算结果相似.



子色散曲线 (实线是 $T_{\rm e} = 0$ eV时的光谱, 虚线是 $T_{\rm e} = 3.395$ eV 时的光谱)

3.3.2 晶格内L点和X点的TA频率ω随电 子温度的变化

图3和图4分别给出了3C-SiC的TA在高对 称点L点和X点的频率 ω 随电子温度的变化.由 图3和图4可以看出:随电子温度的升高,在高对 称的L点和X点TA的频率 ω 都在减小;当电子温 度超过 3.20 eV 时, L 点和 X 点的 TA 的频率 ω 全变 为虚频(图中为负数),表明随电子温度的升高,晶 格内的高对称L点和X点逐渐变得不稳定. 作为 二重简并的TA,当电子温度在0-3.20 eV范围内 时, L 点的两支 TA 频率是相等的, 电子温度的升高 对其几乎没有影响,但当电子温度超过3.2 eV后, 发现L点两支TA的虚频率并不相等,且随电子温 度的升高其差距在增大;对于X点的两支TA,其 $频 \propto \omega$ 随电子温度的变化也有类似的情况,这表明 随电子温度的升高激发了更多价电子进入导带,通 过电子-声子耦合将能量快速传递给晶格导致晶格 软化, 使得 L 点和 X 点的 TA 频率 ω 都在减小; 当 电子温度超过3.20 eV后,晶格也逐渐变得不稳定, 导致L点和X点的TA频率变为虚频,进而简并的 两支TA 虚频率值差距也逐渐加大.

完整的横波声学支变为虚频是由热电子激发诱导的晶格不稳定性的一个明显标志.本文研究显示 3C-SiC 整个晶体各点的完整 TA 支变为虚频的临界电子温度是 3.395 eV, 它是介于 Feng 等^[24] 计

算金刚石结构的碳的临界温度5.5 eV和Recoules 等^[8]研究硅晶体临界温度2.15 eV之间的,而比 Feng等^[24]研究的闪锌矿结构的GaAs和InSb半导 体晶体的临界电子温度1.75 eV和1.25 eV要大,这 是由于3C-SiC晶体的离子性强于GaAs和InSb晶 体的离子性,从而导致稳定性更高的缘故.



图 3 3C-SiC 在 L 点的 TA 频率随电子温度的变化





3.3.3 LO-TO分裂度随电子温度的变化

对于闪锌矿结构的半导体, TO和LO的声子 频率分别为 ω_{TO} 和 ω_{LO} ,表示成Lyddano-Sachs-Teller 关系为^[32]

$$\frac{\omega_{\rm LO}}{\omega_{\rm TO}} = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_\infty}\right)^{1/2},\tag{1}$$

这里, $\varepsilon_0 \ \pi \varepsilon_{\infty} \ \beta$ 別是静电介电常数和高频率介电 常数.在离子晶体中因长光学波产生了极化电场, 导致纵波恢复力增大进而提高了纵波的频率.因此,在q = 0 纵光学波的声子频率被极化电场调高, 这将导致在布里渊区的中心 Γ 点处的 LO 与 TO 的 简并退化,形成 LO-TO 分裂.极化电场的大小是 与正、负离子的有效电荷量有关,有效电荷量越 大, $\omega_{\text{LO}} = \omega_{\text{TO}}$ 之差就越大,因此,LO-TO 分裂大 小 $\delta\omega$ (即分裂度)可以作为评估晶体的离子性强度

的一个重要参数.

3*C*-SiC作为共价晶体,具有一定的离子性, 因此3*C*-SiC在*Γ*点的光学模存在LO-TO分裂. 图 5显示了3*C*-SiC晶体的LO-TO分裂度δω随电 子温度 $T_{\rm e}$ 的变化.



图 5 3C-SiC 在 Γ 点的 LO-TO 分裂度 $\delta \omega$ 随电子温度 $T_{\rm e}$ 的变化

对于闪锌矿结构的砷化镓和锑化铟晶体, Wang等^[33]研究指出, 当 $T_e > 0$ eV时, 因随电子 温度的升高, 晶体显金属特性, 进而导致LO-TO 分裂消失; 而Zijlstra等^[9]则认为, 当 $T_e > 0$ eV时, LO-TO分裂一直存在, 且随电子温度的升高其分 裂度是不规则的; Feng等^[24]研究认为, LO-TO分 裂度随电子温度的升高而减小.

对于具有闪锌矿结构的3C-SiC晶体,由 图5可见:一方面, 3C-SiC晶体LO-TO分裂度值 要大于Feng等^[24]得到的砷化镓和锑化铟晶体的 LO-TO分裂度值,这与3C-SiC晶体的有效电荷 量0.41 e分别大于砷化镓和锑化铟晶体的有效电 荷量0.15 e 与0.21 e是一致的^[32];另一方面,在 0-4.50 eV电子温度范围内,其LO-TO分裂度随 电子温度的升高而增大,超过4.50 eV后随电子温 度的升高而减小. 这可以从图6所示的差分电荷 密度和图7所示的电荷密度来分析. 其中横坐标 轴沿 3C-SiC 晶胞在 (110) 面上的 [110] 方向, 纵坐 标轴沿(110)面上的[001]方向. 在图6(a), (b)和 (c)中,比较差分电荷密度 $\delta(x)$ 大于0.02725 e/a₀³ 等值线围成的区域面积(图中带斜线部分),发现 随电子温度的升高该区域面积减小,表明转移的 电荷随温度的升高而减少,其Si--C共价性减弱, 在电子温度不高的情况下,从共价区域脱离出 来的电子仍然围绕在C原子周围,因此导致3C-SiC 晶体离子性增强, 随电子温度的升高LO-TO 分裂度δω增大.当电子温度 $T_{\rm e} > 4.5$ eV 后,从 图7可以看出:图7(a)中C原子最高电荷密度区 域的电荷密度 $\rho(x) = 0.2255 \text{ e/a}_0^3$,大于图7(b) 中C原子最高电荷密度区域的 $\rho(x)$ (0.213 e/a}_0^3), 且C原子周围其他区域也有类似的情况,表明 随电子温度的升高,C原子周围的电子数量进 一步减少,而Si原子周围的电子数量变化也有 类似的情况.由此可知,原胞中C原子和Si原子 周围的价电子数减少,在总价电子数不变的情况下,



图 6 $T_{\rm e}$ 不同时 3*C*-SiC 晶体位于 (110) 面上的差分电荷 密度 $\delta(x)$ (単位为 a_0^3) (a) $T_{\rm e} = 0$ eV; (b) $T_{\rm e} = 3$ eV; (c) $T_{\rm e} = 4.5$ eV

就会有部分价电子从C原子和Si原子周围转移到 原胞体积空间内成为游离状态的自由价电子,导致 空隙区域游离状态的电子数量增多,即电子在高 温下空间均匀化加强,这可能导致其金属性增强 和3C-SiC 晶体离子性减弱,表现出LO-TO分裂度 δω随电子温度的增大而减小.这表明3C-SiC 晶体 在Γ点的LO-TO分裂度δω并不随电子温度的升 高而消失,而是呈现一定的规律性变化.





图 7 $T_{\rm e}$ 不同时 3*C*-SiC 晶体位于 (110) 面上的电荷密度 $\rho(x)$ (单位为 a_0^3) (a) $T_{\rm e} = 4.5$ eV; (b) $T_{\rm e} = 8$ eV

4 结 论

在不同电子温度下,本文对闪锌矿结构的3C-SiC半导体晶格参数a进行了计算.结果表明,3C-SiC晶格随电子温度的升高而膨胀,这与金刚石结构的碳^[24]和硅^[25,26]的理论和实验结果非常类似.

此外,我们使用基于密度泛函微扰理论的线 性响应方法,计算了闪锌矿结构的3C-SiC半导体 在不同电子温度下的声子谱,发现TA在足够高的 电子温度下软化,这一现象表明在强的激光辐照 下3C-SiC晶体变得不稳定.3C-SiC晶体TA全变 为虚频的临界电子温度是 3.395 eV, 它是介于 Feng 等^[24] 计算金刚石结构的碳和硅的临界电子温度 5.5 eV 和2.15 eV之间, 比 Feng等^[24] 计算闪锌矿结 构的砷化镓和锑化铟的临界电子温度1.75 eV 和 1.25 eV 要大. 当电子温度升高到 3.2 eV 后, 3C-SiC 晶体在高对称点 L 点和 X 点的两支 TA 不再是简 并的, 且差距随电子温度的继续升高而加大; 作 为具有一定离子性的共价晶体 3C-SiC, 在高对称 点 Γ处存在 LO-TO 分裂度且有一定的规律性; 在 0—4.50 eV 电子温度范围内, 发现 LO-TO 分裂度 随电子温度的升高而增大, 晶体的离子性增强, 超 过 4.50 eV 后又逐渐减小. 表明只有在足够强的激 光辐照下, 电子激发才能削弱 3C-SiC 晶体的离子 性强度.

参考文献

- [1] van Vechten J A, Tsu R, Saris F W 1979 *Phys. Lett. A* 74 422
- [2] Shank C V, Yen R, Hirlimann C 1983 *Phys. Rev. Lett.* 50 454
- [3] Larsson J, Heimann P A, Lindenberg A M, Schuck P J, Bucksbaum P H, Lee R W, Padmore H A, Wark J S, Falcone R W 1998 Appl. Phys. A 66 587
- [4] Uteza O P, Gamaly E G, Rode A V, Samoc M, Luther-Davies B 2004 Phys. Rev. B 70 054108
- [5] Saeta P, Wang J, Siegal Y, Bloembergen N, Mazur E 1991 Phys. Rev. Lett. 67 1023
- [6] Silvestrelli P L, Alavi A, Parrinello M, Frenkel D 1997 Phys. Rev. B 56 3806
- [7] Silvestrelli P L, Alavi A, Parrinello M, Frenkel D 1996 *Phys. Rev. Lett.* 7 3149
- [8] Recoules V, Clérouin J, Zérah G, Anglade P M, Mazevet S 2006 Phys. Rev. Lett. 96 055503
- [9] Zijlstra E S, Walkenhorst J, Gilfert C, Sippel C, Töws
 W, Garcia M E 2008 Appl. Phys. B 93 743
- [10] Deng X C, Sun H, Rao C Y, Zhang B 2013 Chin. Phys. B 22 017302
- [11] Song Q W, Zhang Y M, Han J, Tanner S P, Dimitrijev S, Zhang Y M, Tang X Y, Guo H 2013 Chin. Phys. B 22 027302
- [12]~Liu L, Yang Y T, Ma X H 2011 $\mathit{Chin.~Phys.~B}$ 20 127204
- [13] Zheng L, Zhang F, Liu S B, Dong L, Liu X F, Fan Z C, Liu B, Yan G G, Wang L, Zhao W S, Sun G S, He Z, Yang F H 2013 Chin. Phys. B 22 097302
- [14] Liu Z L 2009 Power Electron. 6 10 (in Chinese) [刘忠立 2009 电力电子 6 10]
- [15] Gao S P, Zhu T 2012 Acta Phys. Sin. 61 137103 (in Chinese) [高尚鹏, 祝桐 2012 物理学报 61 137103]
- [16] Lü M Y, Chen Z W, Li L X, Liu R P, Wang W K 2006
 Acta Phys. Sin. 55 3576 (in Chinese) [吕梦雅, 陈洲文,
 李立新, 刘日平, 王文魁 2006 物理学报 55 3576]

- [17] Zhou P L, Zheng S K, Tian Y, Zhang S M, Shi R Q, He J F, Yan X B 2014 Acta Phys. Sin. 63 053102 (in Chinese) [周鹏力, 郑树凯, 田言, 张朔铭, 史茹倩, 何静芳, 闫小兵 2014 物理学报 63 053102]
- [18] Gonze X, Beuken J M, Caracas R, Detraux F, Fuchs M, Rignanese G M, Sindic L, Verstraete M, Zerah G, Jollet F, Torrent M, Roy A, Mikami M, Ghosez P, Raty J Y, Allan D C 2002 Comput. Mater. Sci. 25 478
- [19] The ABINIT code is a common project of the Universite Catholique de Louvain, Corning Incorporated, and othercontributors http://www.abinit.org [2013-11-23]
- [20] Troullier N, Martins J L 1990 Solid State Commun. 74 613
- [21] Ashcroft N W, Mermin N D 1976 Solid State Physic (Independence Ky: Thomson Learning Inc) p81
- [22] Käckell P, Wenzien B, Bechstedt F 1994 *Phys. Rev. B* 50 10761
- [23] Choyke W J, Hamilton D R, Patrick L 1964 Phys. Rev. 133 A1163
- [24] Feng S Q, Zhao J L, Cheng X L 2013 J. Appl. Phys. 113 023301

- [25] Thompson M O, Galvin G J, Mayer J W, Peercy P S, Poate J M, Jacobson D C, Cullis A G, Chew N G 1984 *Phys. Rev. Lett.* **52** 2360
- [26] Poate J M, Brown W L 1982 Phys. Today 35 24
- [27] Feldman D W, Parker J H, Choyke W J, Patrick L 1968 Phys. Rev. 173 787
- [28] Olego D, Cardona M 1982 Phys. Rev. B 25 1151
- [29] Olego D, Cardona M, Vogl P 1982 Phys. Rev. B 25 3878
- [30] Karch K, Pavone P, Windl W, Schütt O, Strauch D 1994 *Phys. Rev. B* **50** 17054
- [31] Serrano J, Strempfer J, Cardona M, Schwoerer-Böhning M, Requardt H, Lorenzen M, Stojetz B, Pavone P, Choyke W J 2002 Appl. Phys. Lett. 80 4360
- [32] Huang K, Han R Q 1988 Solid State Physics (1st Ed.) (Beijing: Higher Education Press) pp63-107 (in Chinese) [黄昆, 韩汝琦 1988 固体物理学 (第一版) (北京:高等教育出版社) 第63—107 页]
- [33] Wang M M, Gao T, Yu Y, Zeng X W 2012 Eur. Phys.
 J. Appl. Phys. 57 10104

Effect of intense laser irradiation on the structural stability of 3C-SiC^{*}

Deng Fa-Ming^{1)2)†} Gao Tao^{2)‡} Shen Yan-Hong²⁾ Gong Yan-Rong²⁾

1) (Mathematics Department, Sichuan University for Nationalities, Kangding 626001, China)

(Institute of Atomic and Molecular Physics, Sichuan University, Chengdu 610065, China)
 (Received 7 July 2014; revised manuscript received 17 September 2014)

Abstract

Using the linear response method based on the density functional perturbation theory, we simulate the effect of intense laser irradiation on the zinc-blende structural stability of silicon carbide crystal. By calculating the phonon dispersion curves for the 3C-SiC crystal of the zinc-blende structure at different electronic temperatures, we find that the transverse acoustic phonon frequencies of 3C-SiC become imaginary as the electron temperature increases. The critical electronic temperature is 3.395 eV. This means that the lattices of 3C-SiC become unstable under the intense laser irradiation. These results are very similar to the previous results for the diamond structure (C and Si) and the zinc-blende structure (GaAs and InSb). In an electron temperature range of 0–4.50 eV, the LO-TO splitting at Γ gradually increases with the increase of electronic temperature. When the electron temperature is beyond 4.50 eV, the splitting decreases. The results indicate that only under the intense enough laser irradiation, the ionic strength can be weakened by the electronic excitation.

Keywords: 3C-SiC, lattice stability, laser irradiation, density functional perturbation theoryPACS: 63.10.+a, 71.15.mb, 61.72.uj, 81.10.AjDOI: 10.7498/aps.64.046301

^{*} Project supported by the National Key Technology Research and Development Program of the Ministry of Science and Technology of China (Grant Nos. 2014GB111001, 2014GB125000).

[†] Corresponding author. E-mail: dfm@scun.edu.cn

[‡] Corresponding author. E-mail: gaotao@scu.edu.cn